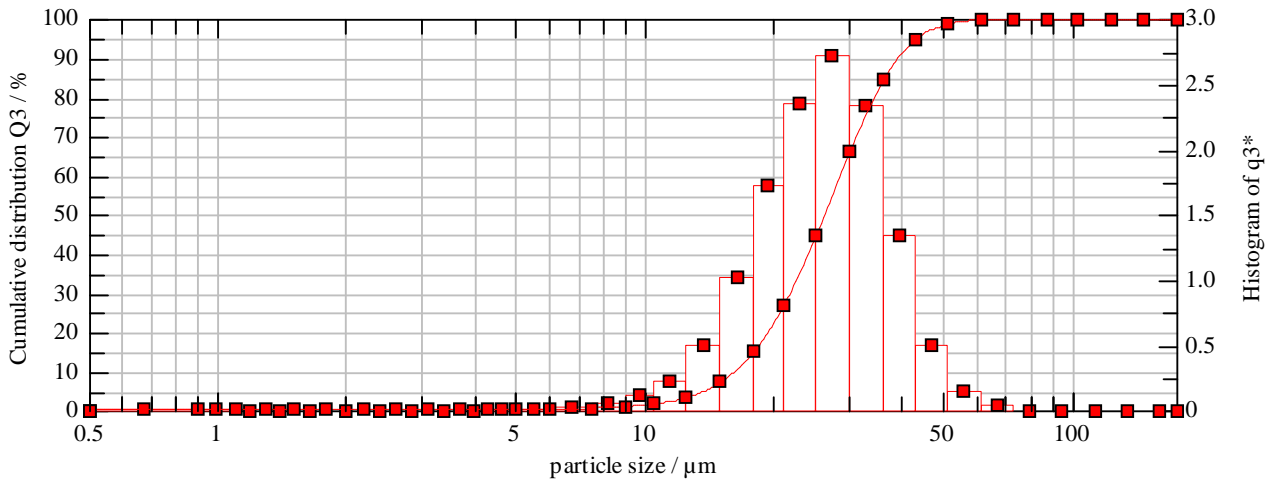




HELOS (H0124) & QUIXEL, R3: 0.5/0.9...175µm
SiC-P600'98

2000-11-21, 11:36:52,2872

$x_{10} = 16,02 \mu\text{m}$	$x_{50} = 26,25 \mu\text{m}$	$x_{90} = 39,70 \mu\text{m}$	SMD = 23,45 µm	VMD = 27,18 µm
$x_{16} = 18,19 \mu\text{m}$	$x_{84} = 35,82 \mu\text{m}$	$x_{99} = 54,78 \mu\text{m}$	$S_V = 0,26 \text{ m}^2/\text{cm}^3$	$S_m = 795,51 \text{ cm}^2/\text{g}$



comment:
KFS 1112,

user parameters:
P1: hal
P2: QU 216, Kuev. 2mm 100_1
P3:

cumulative distribution

$x_0/\mu\text{m}$	$Q_3/\%$	$x_0/\mu\text{m}$	$Q_3/\%$	$x_0/\mu\text{m}$	$Q_3/\%$	$x_0/\mu\text{m}$	$Q_3/\%$
0,90	0,02	3,70	0,08	15,00	7,26	61,00	99,69
1,10	0,08	4,30	0,08	18,00	15,29	73,00	100,00
1,30	0,08	5,00	0,10	21,00	26,77	87,00	100,00
1,50	0,08	6,00	0,21	25,00	44,62	103,00	100,00
1,80	0,08	7,50	0,47	30,00	66,08	123,00	100,00
2,20	0,08	9,00	0,90	36,00	84,56	147,00	100,00
2,60	0,08	10,50	1,63	43,00	94,86	175,00	100,00
3,10	0,08	12,50	3,33	51,00	98,58		

density distribution (log.)

$x_m/\mu\text{m}$	q_3/g	$x_m/\mu\text{m}$	q_3/g	$x_m/\mu\text{m}$	q_3/g	$x_m/\mu\text{m}$	q_3/g
0,67	0,00	3,39	0,00	13,69	0,50	55,78	0,14
0,99	0,01	3,99	0,00	16,43	1,01	66,73	0,04
1,20	0,00	4,64	0,00	19,44	1,72	79,69	0,00
1,40	0,00	5,48	0,01	22,91	2,36	94,66	0,00
1,64	0,00	6,71	0,03	27,39	2,71	112,56	0,00
1,99	0,00	8,22	0,05	32,86	2,33	134,47	0,00
2,39	0,00	9,72	0,11	39,34	1,33	160,39	0,00
2,84	0,00	11,46	0,22	46,83	0,50		

evaluation: WINDOX 5.1.2.7, HRLD

revalidation:
reference measurement: 11-21 11:34:10
contamination: 0,00 %

product: SiC-P600'98

density: 3,22 g/cm³
shape factor: 1,00
 $C_{opt} = 20,49 \%$

trigger condition: 10s (QUIXEL, SUCELL, CUVETTE)

time base: 1000,00 ms
start: button
valid: always
stop: 10s real time

dispersing method: QUIXEL SiC-P600

dispersant: Water+NA4P2O7, temperature: 25,00 °C
size of cuvette: 2 mm
sonication duration: 60,00 s, pause: 10,00 s
pump speed: 30,00 %